一般社団法人 日本真空学会 機能薄膜部会 ナノ・キャラクタリゼイション専門部会 第4回研究会

テーマ:膜の密着

成膜した物を製品として使用する場合、「膜と膜」や「膜と基材」の密着性は製品の品質や耐久性を決める非常に重要な機械特性です。その評価方法は、接着剤で薄膜上に貼り付け、物体に力を加えて薄膜を剥がして評価する接着法や薄膜に直接力を加えて薄膜を引きはがす引っ掻き法(SAICAS 法やスクラッチ試験)等で行われており、定量性や得られたデータの解釈については様々な議論が行われております。

今回は引っ掻き法に焦点を当て、装置メーカーと大学の先生をそれぞれ2名ずつお招きして、最新の膜の密着性評価に関して理論から最新のアプリケーションまでご講演いただきます。講演終了後、引き続き会場にて簡単な交流会を開催させていただき、参加された皆さんから忌憚の無い意見をいただいて、今後の本専門部会での活動や議論につながる機会としたいと考えております。多くの皆様の参加と活発な議論を期待いたします。

〈プログラム〉

13:00- 受付開始

13:30-13:40 開会の挨拶 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 大村孝仁(専門部会委員長)

13:40-14:25 ナノ切削による薄膜評価法

東京大学 大学院 総合文化研究科 斎藤文修

14:25-15:05 密着性評価を目的としたスクラッチ試験のシミュレーションについて

㈱アントンパール・ジャパン グウェン ボロレ

15:05-15:20 休憩

15:20-16:00 マイクロスクラッチ試験法を用いた薄膜密着性評価の解説

㈱レスカ 新井大輔

16:00-16:45 膜の密着~スクラッチ試験やナノインデンテーション測定からわかる事~

東京理科大学大学院 工学研究科 佐々木信也

16:45-16:55 閉会の挨拶 オミクロン ナノテクノロジー ジャパン㈱

大岩 烈(真空学会理事)

(17:00-19:00) 交流会

(敬称略)

主 催:一般社団法人 日本真空学会 機能薄膜部会 ナノ・キャラクタリゼイション専門部会

日 時: 平成27年5月19日(火)13:30~

会 場:東陽テクニカ テクノロジーインターフェースセンター

参加費:機能薄膜部会委員:無料 (資料代) 日本真空学会会員:1,000円 学生:無料

その他:2,000円

申し込み先: 一般社団法人 日本真空学会 事務局 TEL: 03-3431-4395 FAX: 03-3433-5371

e-mail:ofc-vsj@vacuum-jp.org でお申込みください.

問い合わせ先:ナノ・キャラクタリゼイション専門部会 担当委員

オミクロンナノテクノロジージャパン株式会社 大川登志郎 TEL: 03-6732-8964 e-mail: t.okawa@omicron.oxinst.com

会場案内: 東陽テクニカ テクノロジーインターフェースセンター

http://www.toyo.co.jp/company/access.html#honsya

[地下鉄] 銀座線/東西線:日本橋駅 A1 出口から徒歩5分銀座線/半蔵門線:三越前駅

B3 出口(半蔵門線のみ)から徒歩1分/B5出口から徒歩5分

[JR] 東京駅八重洲北口徒歩7分

